ویژگی های ساختاری و الکترونی تکلایه های گرافین گونه Mo_xNb_{1-x}S₂ (1 ≥ x ≥ 0): محاسبات اصول اولیه کشاورز صفری، ابراهیم'؛ شکری، علی اصغر^۲

۲ گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیدہ

در این مقاله، با استفاده از محاسبات اصول اولیه مبتنی بر نظریه تابعی چگالی به بررسی تغییرات گاف نواری و چگالی حالات آلیاژهای دویعدی تکلایه Mo_xNb_{1-x}S₂. (1 ≥ x ≥ 0) که دارای ساختاری گرافینگونه است پرداختهایم. ویژگیهای ساختاری از قبیل طولهای پیوند واهلشیافته، ثابتهای شبکه، ضخامت لایهها و نیز ویژگیهای الکترونی از قبیل رسانندگی الکتریکی و ساختار نواری این آلیاژ با درصدهای متفاوتی از اتمهای مولیبدن و نیوبیم به دست آوردهایم. نتایج نشان میدهند که ورقه NbS₂ گرافینگونه خالص (x = 0) رسانا بوده و با افزایش درصد اتمهای MO، از میزان رسانندگی الکتریکی این آلیاژهای دوبعدی کاسته می شود، بهطوری که ورقه MoS₂ گرافینگونه خالص (x = 1) یمه رساناست.

Structural and Electronic Properties of Graphene-Like $Mo_xNb_{1-x}S_2$ ($0 \le x \le 1$) Monolayers: First Principles Calculations

Keshavarz Safari, Ebrahim¹; Shokri, Ali Asghar²

¹ Department of Physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan ² Department of Physics, Payame Noor University, Tehran

Abstract

In this paper, using the first-principles calculations based on density functional theory (DFT), we have been studied the changes in band-gap and density of states of monolayer $Mo_xNb_{1-x}S_2$ ($0 \le x \le 1$) 2D-alloys that have graphene-like structures. We obtained the structural properties such as relaxed bond lengths, lattice constants, thickness of layers, as well as electronic properties such as electrical conductivity and band structure of these alloys containing of various percentages of molybdenum and niobium atoms. The results show that graphene-like pure NbS₂ sheet (x=0) is conductor and as Mo atoms' percentages rise, the value of electrical conductivity of these 2D-alloys is reduced, so that graphene-like pure MoS₂ sheet (x=1) is semiconductor.

PACS No. 70, 75, 80, 81.

مواد که لایه های متشکل از پیوندهای کووالانسی آن ها توسط نیروهای ضعیف واندروالس بر روی هم انباشه شدهاند [٤-٧]، منبع غنی از مواد دوبعدی هستند. حالت توده این مواد، محدوده متنوعی از ویژگیهای الکترونی از عایق ها مثل دHfS، نیمهرساناها مثل MoS₂ و WTe2، شبه فلزات مثل دTiSe و TiSe، تا فلزات واقعی همچون 2NB و S22 را شامل می شوند [۵].

در سالهای اخیر، مواد دوبعدی از قبیل گرافین [۱]، نیترید بور [۲] و دی سولفید مولیبدن [۳] به خاطر ساختارهای منحصربهفرد، ویژگیهای فیزیکی بنیادی و کاربردهای بالقوهای که دارند توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کردهاند. کالکوژنهای فلزات واسطه Mo, W, Nb, Ta; X=S, Se, Te)، دستهای از

مقدمه

ورقههای دی سولفید مولیبدن و دی سولفید نیوبیم (NbS₂) دو نمونه از مواد دوبعدی با ساختار گرافین گونه هستند که به ترتیب نیمهرسانا و رسانا هستند. از آنجاکه اتمهای سولفور در این دو ماده یکسان هستند، اختلاف در رسانندگی الکتریکی آنها را می توان به اتمهای مولیبدن و نیوبیم نسبت داد. با جایگزینی اتمهای مولیبدن در MOS₂ با اتمهای نیوبیم، آلیاژی با فرمول شیمیایی Mo_xNb_{1-x}S₂ به دست می آید که x، درصد اتمهای مولیبدن دستنخورده است.

در این مقاله قصد داریم با استفاده از محاسبات اصول اولیه مبتنی بر نظریه تابعی چگالی، تغییرات ویژگی های ساختاری و الکترونی این آلیاژ را نسبت به درصد مولیبدن موجود در آن بررسی نماییم.

روشها و مدلها

در شکل ۱ نماهای فوقانی و جانبی ساختار گرافین گونه دوبعدی سولفید مولیبدن و سولفید نیوبیم مشاهده می شود. شبکه بلوری این مواد به شکل هگزاگونال لانهزنبوری از دو زیر شبکه تشکیل شده است که به دلیل نسبت ۱ به ۲ بودن تعداد اتمهای فلز واسطه و سولفور، زیر شبکه متشکل از جایگاههای فلزی (M) بین دو لایه از زیر شبکه متشکل از جایگاههای سولفور (S) ساندویچ می شود. ضخامت این ورقه با h معرفی شده است. برای مطالعه آلیاژی مرکب از اتمهای M0 و Nb در جایگاههای M سلولهای قرارداری به ابعاد ۲×۲ به طول a انتخاب کرده ایم که شامل ٤ جایگاه فلزی و ۸ جایگاه سولفور است.

محاسبات اصول اولیه توسط بسته شبیه سازی وسپ (VASP) [۸ و ۹] به همراه یک مجموعه موج تخت و شبه پتانسیل های موج تقویت شده تصویر گر [۱۰ و ۱۱] انجام شده است. برای این منظور از تابعی های تبادلی و همبست گی ارائه شده توسط پردو – برک –

جدول ۱. ویژگیهای ساختاری دیسولفید مولیبدن و دیسولفید نیوبیم.

$\frac{E_{form}}{\left(\frac{eV}{atom}\right)}$	$\frac{E_c}{\left(\frac{eV}{atom}\right)}$	$S_1 \widehat{M_2} S_2$ $= M_1 \widehat{S_1} M_2$	$S_1\widehat{M_1}S_1'$	$d_{M-S} \ (m \AA)$	h (Å)	a (Å)	ساختار
-1/22	-0/•9	A1/AY	۸١/٧٤	<u> </u>	٣/١١٩	7/727	MoS ₂
-1/0A	-0/EV	۸۳/۰۳	VA/VV	٢/٤٤٨	٣/١٠٦	٦/٥٥٣	NbS ₂



شکل ۱. نماهای فوقانی و جانبی ساختار بلوری ورقه گرافینگونه MX₂ (M=Mo, Nb).

ارنزرهوف (PBE) [۱۲] در تقریب گرادیان تعمیمیافته (GGA) استفاده شده است. انرژی قطع موج تخت به ۲۰۰ الکترونولت تنظیم شده است. برای ایزوله کردن لایهها و حذف برهمکنش بین لایهای، فاصله بین آنها بیش از ۲۰ آنگستروم انتخاب شده است. ثابتهای شبکه و مختصات اتمی تا آنجا بهینه شدهاند که نیروی هر اتم به کمتر از ۲۰/۰ الکترونولت بر آنگستروم برسد. برای نمونهبرداری از شبکه وارون و منطقه اول بریلوئن از طرح مونخورست – پک [۱۳] با شبکههای ۱×۲×۲ برای محاسبات واهلش ساختاری و ۱×۲۵ برای محاسبات چگالی حالتها (DOS) استفاده شده است.

نتايج و بحث

در جدول ۱ تعدادی از ویژگیهای واهلشیافته ساختاری ورقههای دوبعدی دیسولفید مولیبدن و دیسولفید نیوبیم شامل طول سلول قراردادی (a)، ضخامت ورقه (h) طول پیوند فلز-سولفور



شکل ۲. طولهای پیوند برحسب آنگستروم برای آلیاژهای گرافین گونه دوبعدی Mo_xNb_{1-x}S₂ به ازای x=0.75 و x=0.75.

$$E_{c}(MS_{2}) = E_{MS_{2}} - E_{M_{atom}} - 2 \times E_{S_{atom}}$$
(1)

تعریف کردهایم که در آن E_{MX_2} انرژی کل ورقه MS_2 بوده و E_{Matom} و E_{Satom} و سولفور E_{Satom} و سولفور MS_2 نیز به ترتیب با انرژی اتمهای فلزی و سولفور متناظرند. هر چه انرژی همدوسی منفی تر باشد، ورقه MS_2 مطلوب تر خواهد بود. از این جدول مشاهده می شود که $E_c(MS_2) < E_c(MOS_2)$

ما انرژی تشکیل ورقههای MS₂ را نیز به صورت

 $E_{form} = E_{MX_2} - E_{M Bulk} - 2 \times E_{X dimer}$ (7)

تعریف کردهایم. $E_{M Bulk}$ و $E_{X dimer}$ به ترتیب انرژیهای اتمی در ساختارهای عنصری پایدارشان هستند. برای فلزات، ساختار پایدار یک توده مرکز حجمی (bcc) با گروه فضایی MS - Mr بوده، درحالی که ساختار پایه سولفور یک مولکول دوپار است. همان طور که در جدول ۱ نشان داده شده است، ورقههای MS_2 دارای انرژی تشکیل منفی هستند. در شکل ۲، طولهای پیوند در واحد آنگستروم برای آلیاژهای گرافین گونه $Mo_xNb_{1-x}S_2$ به ازای x=0.75 و x=0.75

در ادامه، محاسبات چگالی حالتها و ساختار نواری ورقههای تکلایه $Mo_xNb_{1-x}S_2$ انجام شده و ویژگی الکترونی این آلیاژهای دوبعدی بررسی شدهاند. در شکل ۳، نمودارهای ساختار نواری این مواد به ازای x=0 (NbS2) x=0 محالص) ، x=0.25 ده x=0.75 و x=1 (MoS2) x=1 خالص) نشان داده شده است. در NbS2 خالص یک گاف انرژی غیرمستقیم ($K \leftarrow T$) به مقدار ۱/٤۵ الکترونولت وجود دارد. بااین حال سطح فرمی، برخی از نوارهای انرژی را قطع کرده و تعدادی نوار نیمه پر در نمودار مربوطه مشاهده می شود. بنابراین این ساختار رساناست.

از سوی دیگر، در MoS₂ خالص نیز یک گاف انرژی مستقیم واقع در نقطه K به مقدار ۱/۹۱ الکترونولت موجود است. از آنجاکه سطح فرمی در این ناحیه واقعشده و نوارهای کاملاً پر و کاملاً خالی از یکدیگر جدا شدهاند، این ساختار نیمهرساناست. همان طور که مشاهده می شود، در آلیاژهای ناخالص Mo_xNb_{1-x}S₂، هرچه درصد اتمهای مولبیدن در ترکیب افزایش مییابد، تعداد نوارهای نیمه پر و درنتیجه رسانندگی الکتریکی این آلیاژها کاهش مییابد. با بررسی نمودارهای چگالی حالتها نیز می توان این موضوع را



شکل ۳. ساختار نواری Mo_xNb_{1-x}S₂ به ازای (الف) x=0.3، (ب) x=0.25، (پ) x=0.5 و (ت) x=0.75. (ت) x=1. انرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.



شکل ٤. چگالی حالتهای کل برای آلیاژهای دوبعدی گرافینگونه MoxNbLxS2 و چگالی حالتهای جزئی برای ساختارهای خالص NbS2 و MoS2.

مرجعها

K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, *et al.*, Electric field effect in atomically thin carbon films, *science* **306** (2004) 666-669.

- [2] Y. Zhou, X. Jiang, G. Duan, F. Gao, and X. T. Zu, Spin and band-gap engineering in copper-doped BN sheet, *Chemical Physics Letters* 491 (2010) 203-207.
- [3] X. Huang, Z. Zeng, and H. Zhang, Metal dichalcogenide nanosheets: preparation, properties and applications, *Chemical Society Reviews* 42 (2013) 1934-1946.
- [4] Q. H. Wang, K. Kalantar-Zadeh, A. Kis, J. N. Coleman, and M. S. Strano, Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides, *Nature nanotechnology* 7 (2012) 699-712.
- [5] M. Chhowalla, H. S. Shin, G. Eda, L.-J. Li, K. P. Loh, and H. Zhang, The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets, *Nature chemistry* 5 (2013) 263-275.
- [6] W. S. Yun, S. Han, S. C. Hong, I. G. Kim, and J. Lee, Thickness and strain effects on electronic structures of transition metal dichalcogenides: 2H-M X 2 semiconductors (M= Mo, W; X= S, Se, Te), *Physical Review B* 85 (2012) 033305.
- [7] A. Kumar and P. Ahluwalia, Electronic structure of transition metal dichalcogenides monolayers 1H-MX2 (M= Mo, W; X= S, Se, Te) from ab-initio theory: new direct band gap semiconductors, *The European Physical Journal B* 85 (2012) 1-7.
- [8] G. Kresse and J. Furthmüller, Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set, *Computational Materials Science* 6 (1996) 15-50.
- [9] G. Kresse, J. Furthmüller, and J. Hafner, Theory of the crystal structures of selenium and tellurium: The effect of generalizedgradient corrections to the local-density approximation, *Physical Review B* 50 (1994) 13181.
- [10] G. Kresse and D. Joubert, From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method, *Physical Review B* 59 (1999) 1758.
- [11] P. E. Blöchl, Projector augmented-wave method, *Physical Review B* 50 (1994) 17953.
- [12] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, *Physical review letters* 77 (1996) 3865.
- [13] H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Special points for Brillouin-zone integrations, *Physical review B* 13 (1976) 5188.

شدهاند. همان طور که می بینیم، چگالی حالت ها در انرژی فرمی با افزایش درصد مولیبدن در آلیاژ مذکور (x) کاهش می یابد. در نتیجه رسانندگی مواد از NbS2 خالص به سمت MoS2 خالص نیز کاهش می یابد. به طوری که ساختار اخیر یک ماده نیمه رساناست. در نمودارهای چگالی حالت های جزئی سهم هر یک از اور بیت ال های اتم های فلزی و سولفور نشان داده شده است. در اطراف انرژی فرمی سهم اور بیتال هال d اتم فلزی و اور بیتال های p اتم سولفور بیشتر است.

نتيجهگيرى

در این مقاله، بهطور خلاصه خواص ساختاری و الکترونی آلیاژهای دوبعدی گرافین گونه Mo_xNb_{1-x}S₂ با استفاده از روش محاسبات اصول اولیه مطالعه و بررسی شد. دیسولفید نیوبیم خالص مادهای رسانا و دیسولفید مولیبدن خالص مادهای نیمهرسانا با گاف نواری مستقیم واقع در نقطه K به مقدار ۱/۹۱ الکترونولت هستند. در آلیاژهای ترکیبی از این دو عنصر، با افزایش درصد مولیبدن، تعداد نوارهای نیمه پر در سطح فرمی و درنتیجه میزان رسانندگی الکتریکی آن کاهش مییابد.